

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 8 月 24 日 (2006.8.24)

【公開番号】特開 2000-39727 (P2000-39727A)

【公開日】平成 12 年 2 月 8 日 (2000.2.8)

【出願番号】特願 平 11-197523

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/42 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/42

H 0 1 L 21/30 5 7 2 B

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 7 月 10 日 (2006.7.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

5 ~ 15 重量 % のアルカノールアミンと、
35 ~ 55 重量 % のスルホキシド化合物又はスルホン化合物と、
35 ~ 55 重量 % のグリコールエーテルとを含むことを特徴とするフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項 2】

前記アルカノールアミンは、モノイソプロパノールアミン及びモノエタノールアミンからなる群より選択される少なくとも 1 つの化合物を含む請求項 1 に記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項 3】

前記スルホキシド化合物は、ジメチルスルホキシド及びジエチルスルホキシドからなる群より選択される少なくとも 1 つの化合物を含み、前記スルホン化合物は、ジエチルスルホン及びジメチルスルホンからなる群より選択される少なくとも 1 つの化合物を含む請求項 1 又は 2 に記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

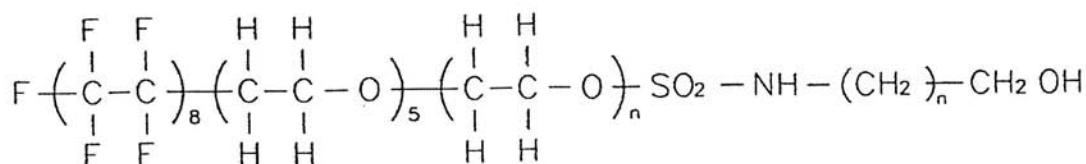
【請求項 4】

前記グリコールエーテルは、エチルジグリコール、メチルジグリコール及びブチルジグリコールからなる群より選択される少なくとも 1 つの化合物を含む請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項 5】

さらに、

【化 1】



(式中、 n は 0 又は 1 ~ 10 の整数)

で表される群より選択される少なくとも 1 つの界面活性剤を含む請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項 6】

さらに、1 ~ 10 重量 % の水酸化テトラメチルアンモニウム及び 3 ~ 15 重量 % のベンゼンジオールからなる群より選択される少なくとも 1 つの化合物を含む請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項 7】

さらに、1 ~ 15 重量 % のアルキルスルホン酸を含む請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項 8】

10 重量 % のアルカノールアミンと、45 重量 % のスルホキシド化合物又はスルホン化合物と、45 重量 % のグリコールエーテルとを含む請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項 9】

フォトレジストを剥離するためのエアナイフ工程又は浸漬法を使った単一ウェハ処理方法に適用可能である請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。